



コンタクト:

David Moreno

MCA

Tel: +1-650-968-8900, ext. 125

E-mail: dmoreno@mcapr.com

フォトマスクおよび半導体業界のベテランが D2S 社の経営チームに参画

Intel 社、KLA-Tencor 社と Synopsys 社での豊富な半導体経験と優れた英知を持つ人材を入れることで、D2S 社が次の成長段階に入る

SAN JOSE, Calif., February 13, 2012—コンピュータ設計プラットフォームメーカーである D2S®社は、本日、電子ビーム(eBeam)、フォトマスクおよび露光技術における事業と技術に関し特に造詣の深い3人の半導体業界ベテラン人材が経営チームに参画したと発表した。Sterling Watson 氏は、技術担当副社長(vice president of engineering)として、Anthony Adamov 氏は事業開発副社長(vice president of business development)として、また、Ryan Pearman 氏はモデリング担当ディレクター(director of modeling)として D2S に入社した。

発表に際し、D2S 社 CEO Aki Fujimura 氏は「Sterling 氏と Anthony 氏、Ryan 氏を D2S 社は喜んで迎えます。彼らは、半導体設計、フォトマスクおよび露光プロセス技術の先端企業での豊かな経験と、また、各自の持つ深い造詣を弊社に持ち込んでくれます。彼らは 20nm 世代とそれ以降でのマスク精度向上と描画時間削減に貢献するモデルベース マスクデータ編集(MB-MDP)などの革新的な eBeam 技術関連商品をお客様に弊社がご提供する際、必須の人材となります」とコメントしています。

Watson 氏は、前職 KLA-Tencor 社で Chief Technology Supply Officer でした。Watson 氏は KLA-Tencor 社での18年のキャリアの中で、電子ビームレビュー装置事業部長(general manager)、レチクルおよびフォトマスク検査事業部(RAPID)担当の技術副社長(vice president of engineering) など複数のマネージメント業務を歴任しています。KLA-Tencor 社以前では、ETEC Systems 社(後に Applied Materials に合併)にて eBeam マスクデータ編集のソフトウェアシステム開発を担当していました。Watson 氏はスタンフォード大学(Stanford University)にて物理学を専攻し、カリフォルニア大学(University of California at Santa Cruz)にて物理学博士号を得ています。

-more-

Adamov 氏は、自身が共同創業者として起業し、CEO として経営していたマスク最適化ソフトウェアの会社である Stanford Robotics 社と共に D2S に入社しました。Adamov 氏は前職 Luminescent Technology 社で事業部長 兼 事業開発副社長 (general manager and vice president of business development) として Inverse Lithography 事業部を率いていました。また、それ以前は Synopsys 社にて、グローバル アプリケーションマネージャ (global application manager) など、エンジニアリングおよびマネジメント職を歴任しています。Adamov 氏は、タフツ大学 (Tufts University) にて理論物理学の博士号を得ています。

Pearman 氏は、Intel 社にて8年を過ごした後、D2S 社に入りました。Intel 社では、クリティカル製造モデル (critical production models) の最適化に責任を持ち、次世代露光モデル (lithography modelling) の開発、パターン形成プロセスでのマスクエラーの影響に関し研究を行っていました。Pearman 氏はイリノイ大学 (University of Illinois) にて物理化学の博士号を得、コロンビア大学 (Columbia University) にてポストドクターの職にありました。

About D2S, Inc.

D2S Inc. は、少量生産・大量生産の両アプリケーション向けのマスク費用を削減するため、既存の電子ビーム・テクノロジーを最大限に生かす半導体 IP とソフトウェアを提供するベンチャー企業です。D2S の先進的な design-for-e-beam (DFEB) マスク・ソリューションは、既存の EB マスク描画装置を利用して複雑かつ曲線形状に対応し、大量生産設計向けのマスク描画にかかる時間を短縮します。D2S の DFEB 直描ソリューションは、少量生産アプリケーション向けのマスク費用をなくし、設計からリソグラフィまでのフローを短縮することにより、製品の市場投入までのタイムトゥマーケットを短縮します。D2S は、eBeam Initiative の managing sponsor です。D2S は、2007 年に設立され、カリフォルニア州サンノゼ市に本社があります。ホームページ : <http://www.design2silicon.com/>

###

D2S とそのロゴは D2S, Inc. の商標です。